¹⁰ Длинноволновые ($\lambda_{0.1} = 10 \,\mu$ m, 296 K) инфракрасные фотоприемники на основе твердого раствора InAsSb_{0.38}

© Р.Э. Кунков, А.А. Климов, Н.М. Лебедева, Т.С. Лухмырина, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, А.А. Усикова

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия e-mail: romunkov@yandex.ru

Поступила в редакцию 12.05.2023 г. В окончательной редакции 29.09.2023 г. Принята к публикации 30.10.2023 г.

Исследованы фотоприемники на основе диодной гетероструктуры с фоточувствительной областью из твердого раствора InAsSb_x (x = 0.38) с длинноволновой границей фоточувствительности $\lambda_{0.1}$ около 10 μ m (296 K). Исследованы зависимости плотности темновых токов и обнаружительной способности в интервале температур 200–425 К. Показано, что экспериментальные образцы характеризуются значениями плотности темновых токов около 500 A/cm² при комнатной температуре, обнаружительной способностью $1.2 \cdot 10^9$ и $5 \cdot 10^9$ сmHz^{1/2}W⁻¹ при комнатной температуре и 250 K соответственно и диффузионным механизмом токопротекания в интервале температур 200–350 K.

Ключевые слова: длинноволновые фотоприемники, полупроводники $A^{III}B^V$, твердые растворы InAsSb, фотодиоды.

DOI: 10.61011/OS.2023.11.57013.5109-23

Введение

Приемники инфракрасного излучения, работающие в длинноволновой области спектра (8-14 µm), являются ключевыми компонентами как тепловизионных и теплопеленгационных систем, так и газоаналитического оборудования в системах безопасности жизнедеятельности и медицинском оборудовании. Фотоприемники на основе диодных гетероструктур с активным слоем из твердых растворов InAs_{1-x}Sb_x являются перспективной альтернативой как наиболее распространенным фотоприемникам на основе полупроводников Кадмий-Ртуть-Теллур (КРТ) [1,2], так и фотоприемникам из полупроводников $A^{III}B^V$ на основе сверхрешеток [3,4]. В зависимости от состава фоточувствительного слоя фотоприемники из InAsSb могут работать как в средневолновой (3-5µm) [5], так и длинноволновой (8-14µm) инфракрасной областях спектра [6].

Экспериментальные результаты

Эпитаксиальные структуры N-InAsSb/InAsSb/P-InAsSbP были получены на подложках нелегированного n^0 -InAs, ориентированного в плоскости (100) методом жидкофазной эпитаксии ЖФЭ и содержали буферный градиентный слой N-InAsSb толщиной $2.5-3.0\,\mu$ m, фоточувствительную область InAsSb_{0.38} толщиной $3.0-3.2\,\mu$ m и контактный слой P-InAsSbP толщиной $1.5-2\,\mu$ m, легированный Zn до концентрации $p \ge 5 \cdot 10^{17}$ сm⁻³. В данной работе представлены результаты для гетероструктуры с номером № 2052. Экспериментальные образцы чипов фотоприемников были полу-

чены методами многостадийной химической фотолитографии. Образцы конструкции "флип-чип" имели квадратную форму размером $250 \times 250 \,\mu$ m и круглую мезу диаметром $100 \,\mu$ m, ограничивающую площадь фоточувствительной области. Для получения экспериментальных образцов фотоприемников производилась иммерсионная стыковка полученных чипов с линзами из германия с просветляющим покрытием диаметром 3.5 mm.

На рис. 1 представлены вольт-амперные характеристики (*a*) и плотности темновых токов (*b*) в интервале температур 200-425 К для образца из гетероструктуры с номером № 2052. Также на рис. 1, *b* нанесены результаты для образца из гетероструктуры с номером № 1511z из работы [7] (2021 г.) по разработке и исследованию фотоприемников с близким составом фоточувствительной области.

Как видно из рисунка, полученные в ходе настоящей работы гетероструктуры, характеризуются меньшими значениями плотности темновых токов при комнатной температуре и менее резкой температурной зависимостью по сравнению с предыдущими результатами, полученными в [7]. В дополнение к этому температурная зависимость плотности темновых токов хорошо аппроксимируется в интервале температур 200–350 К при помощи следующего соотношения:

$$J_0(T) \propto e^{\left(\frac{-m_{0,1}}{kT}\right)},\tag{1}$$

что свидетельствует о доминировании диффузионного механизма токопротекания. В данной формуле $hv_{0.1}$ — энергия длинноволновой границы фоточувствительности по уровню 0.1 от максимума, значение которой близко к



Рис. 1. Вольт-амперные зависимости в интервале температур 200-425 К (*a*) и зависимость плотности темновых токов от температуры (*b*).



Рис. 2. Спектральная зависимость обнаружительной способности в интервале температур 200–425 К (*a*) и температурная зависимость энергии *hv* длинноволновой границы фоточувствительности по уровням 0.5 и 0.1 от максимума (*b*).

ширине запрещенной зоны фоточувствительной области (E_g) .

При дальнейшем понижении температуры наиболее вероятен переход к туннельному механизму токопротекания, о чем может свидетельствовать аппроксимация при помощи соотношения

$$J_0(T) \propto e^{\left(\frac{-hv_{0,1}}{4kT}\right)}.$$
 (2)

Однако данный температурный диапазон выходит за рамки исследования.

На рис. 2 представлены спектры обнаружительной способности (*a*) и величин hv_{max} , $hv_{0.5}$ и $hv_{0.1}$ (*b*) в интервале температур 200–425 К. Как видно из рисунка, экспериментальные образцы характеризуются значениями обнаружительной способности около $1.2 \cdot 10^9 \text{ cmHz}^{1/2} \text{W}^{-1}$ при комнатной температуре и



Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны от состава (a) и зависимость плотности темновых токов от длинноволновой границы $hv_{0.1}$ (b) при 296 K в сравнении с данными из литературы: звездочки — настоящая работа, квадраты — предыдущие работы, в том числе [7], сплошная кривая (a) и штриховая прямая (b) — аппроксимации экспериментальных данных.

публикации.

Заключение

 $5 \cdot 10^9 \, {\rm cmHz^{1/2}W^{-1}}$ при 250 K, достижимые при помощи термоэлектрического охлаждения.

При повышении температуры выше 325-350 К наблюдается поведение длинноволновой границы, отличающееся от такового как у более коротковолновых фотодиодов, так и у близких по составу фотоприемников, описанных ранее [7]. Наиболее наглядно данное отличие иллюстрирует температурная зависимость энергии по уровню 0.5 и 0.1 от максимума фоточувствительности (рис. 2, *b*). Из рисунка видно значительное отклонение экспериментальных данных при повышенных температурах от аппроксимации с учетом зависимости ширины запрещенной зоны InSb от температуры [8].

На рис. З показано сравнение результатов данной работы с зависимостями ширины запрещенной зоны от состава и зависимостями плотностей темновых токов от длинноволновой границы фоточувствительности, взятыми из литературных источников, в том числе из наших предыдущих работ [5–7]. Полученные значения ширины запрещенной зоны при комнатной температуре согласуются с результатами прошлых работ, однако в настоящей работе наблюдается уменьшение плотности темнового тока до 2 раз [7]. Одной из вероятных причин уменьшения плотности тока является улучшение кристаллографического качества полученных слоев, в частности, уменьшение количества дислокаций несоответствия и их концентрации на границе между подложкой и широкозонным "буферным" слоем, что приводит к уменьшению их влияния на оптические и

Однои из вероятных зовать данные фотоприемники при термоэлектрическом охлаждении.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

электрические характеристики фотоприемников на осно-

ве таких структур. Данное предположение основывается на исследовании полученных эпитаксиальных структур

методом просвечивающей электронной микроскопии,

результаты которого будут обсуждаться в отдельной

Были получены экспериментальные образцы длинно-

волновых фотоприемников с активной областью из твер-

дого раствора InAsSb_x ($x \approx 0.38$) с длинноволновой гра-

ницей фоточувствительности $\lambda_{0.1}$ около $10 \,\mu m$ (300 K)

и исследованы их фотоэлектрические свойства в ин-

тервале температур 200-425 К. По сравнению с ре-

зультатами предыдущей работы продемонстрировано

уменьшение плотности темновых токов в два раза и

увеличение обнаружительной способности в полтора

раза при комнатной температуре до значений 500 A/cm²

и $1.2 \cdot 10^9 \, \text{cmHz}^{1/2} \text{W}^{-1}$ соответственно. При темпера-

туре 250 К было получено значение обнаружительной

способности $5 \cdot 10^9 \, \text{cmHz}^{1/2} \text{W}^{-1}$, что позволяет исполь-

Список литературы

- A. Rogalski. Infrared Phys. Technol., 54 (3), 136 (2011). DOI: 10.1016/j.infrared.2010.12.003
- [2] A. Rogalski, P. Martyniuk, M. Kopytko, W. Hu. Appl. Sci., 11 (2), 501 (2021). DOI: 10.3390/s23177564
- [3] D.H. Wu, A. Dehzangi, Y.Y. Zhang, M. Razeghi. Appl. Phys. Lett., 112 (24), 241103 (2018). DOI: 10.1063/1.5035308
- [4] A. Rogalsky, M. Kopytko, P. Martyniuk. Antimonide-based infrared detectors (SPIE press, Bellingham, 2018).
- [5] N.D. Il'inskaya, S.A. Karandashev, A.A. Lavrov, B.A. Matveev, M.A. Remennyi, N.M. Stus', A.A. Usikova. Infrared Phys. Technol., 88, 223(2018).
- [6] R.E. Kunkov, A.A. Klimov, N.M. Lebedeva, T.C. Lukhmyrina, B.A. Matveev, M.A. Remennyy. J. Phys.: Conf. Ser., 1695 (1), 012077 (2020).
- [7] A.A. Klimov, R.E. Kunkov, A.A. Lavrov, N.M. Lebedeva, T.C. Lukhmyrina, B.A. Matveev, M.A. Remennyi. J. Phys.: Conf. Ser., 1851 (1), 012019 (2021).
- [8] New Semiconductor Materials. Biology systems. Characteristics and Properties [Электронныйресурс]. URL: http://www.matprop.ru/InSb_bandstr